

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 2 月 10 日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/012375 A1

(51) 国際特許分類:
C08L 9/04, C08F 2/22, B29C 41/14

C08F 236/12,

(74) 代理人: 山下 昭彦, 外(YAMASHITA, Akihiko et al.);
〒1040031 東京都中央区京橋一丁目16番10号
オークビル京橋4階 東京セントラル特許事務所内
Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/011194

(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 29 日 (29.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-283857 2003 年 7 月 31 日 (31.07.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本
ゼオン株式会社 (ZEON CORPORATION) [JP/JP]; 〒
1008323 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo
(JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 太田 久紀 (OTA,
Hisanori) [JP/JP]; 〒1008323 東京都千代田区丸の内二
丁目6番1号 日本ゼオン株式会社内 Tokyo (JP). 相原
俊仁 (AIHARA, Shunjin) [JP/JP]; 〒1008323 東京都千
代田区丸の内二丁目6番1号 日本ゼオン株式会
社内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: DIPPING COPOLYMER LATEX

(54) 発明の名称: ディップ成形用の共重合体ラテックス

(57) Abstract: The invention provides products of dipping which are excellent in organic solvent resistance and hand and exhibit satisfactory tensile strength and excellent retention of tight adhesion; dipping compositions capable of forming such products; and a dipping copolymer latex suitable for the dipping compositions. A carboxylated acrylonitrile/butadiene copolymer latex which is produced by the copolymerization of a monomer mixture consisting of 1,3-butadiene, acrylonitrile, and methacrylic acid at a specific ratio wherein part of the acrylonitrile and part of the methacrylic acid are added to the polymerization system at a specified time after the initiation of polymerization and in which the copolymer has a content of matter insoluble in methyl ethyl ketone falling within a specific range; and dipping compositions each comprising the latex, a vulcanizing agent, and a vulcanization accelerator.

(57) 要約: 耐有機溶剤性および風合いに優れ、十分な引張強度を有し、かつ密着状態の持続性に優れるディップ成形物、該ディップ成形物を与えるディップ成形用組成物、および該ディップ成形用組成物に好適に使用できるディップ成形用の共重合体ラテックスを提供する。 特定組成の、1, 3-ブタジエン、アクリロニトリル、メタクリル酸からなる単量体混合物を共重合するに際し、アクリロニトリルの一部とメタクリル酸の一部とを、重合開始後、特定の時期に重合反応系に添加して共重合し、得られる共重合体のメチルエチルケトン不溶解分が特定範囲であるカルボキシ変性アクリロニトリル-ブタジエン共重合体ラテックス。該ラテックス、加硫剤および加硫促進剤からなるディップ成形用組成物である。

WO 2005/012375 A1